

PCT
 ORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : H01L 21/00, C25D 7/12	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/55888 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. September 2000 (21.09.00)
--	-----------	---

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/01984
(22) Internationales Anmeldedatum: 8. März 2000 (08.03.00)

(30) Prioritätsdaten:
 199 11 084.0 12. März 1999 (12.03.99) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): STEAG
 MICROTECH GMBH [DE/DE]; Carl-Benz-Strasse 10,
 D-72124 Pliezhausen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KROEBER, Wolfgang
 [DE/DE]; Gartenstrasse 6, D-78166 Donaueschingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, SG, US, europäisches Patent
 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
 LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

*Mit internationalem Recherchenbericht.
 Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
 Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
 eintreffen.*

(54) Title: DEVICE FOR TREATING SUBSTRATES

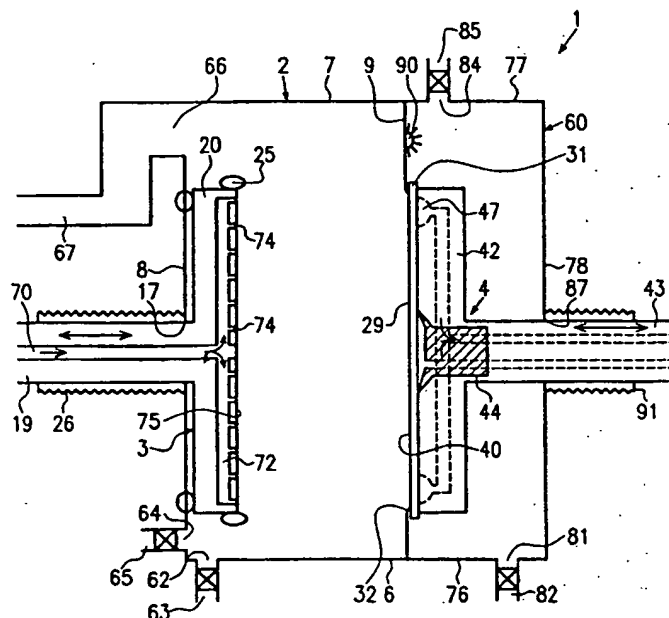
(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON SUBSTRATEN

(57) Abstract

The invention relates to a device for treating sub-
 strates, especially semiconductor wafers, with at least one
 processing container that is provided with an opening which
 can be closed from the exterior during the treatment with
 the substrate. The aim of the invention is to provide a
 simple and homogeneous treatment of a surface pertaining
 to a substrate. The aim of the invention is also to reduce
 the danger of damage between successive treatment steps.
 To this end, a second processing container is provided ad-
 jacent to the first processing container. The wall of said
 second processing container is at least partially the con-
 tainer wall of the first processing container, whereby said
 container wall is provided with the opening which can be
 closed from the side of the first processing container.

(57) Zusammenfassung

Bei einer Vorrichtung zum Behandeln von
 Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, mit wenigstens
 einem eine Öffnung aufweisenden Prozeßbehälter,
 wobei die Öffnung während der Behandlung durch das
 Substrat von außen schließbar ist, wird eine einfache und
 homogene Behandlung einer zu behandelnden Oberfläche
 des Substrats und eine Verringerung der Gefahr einer
 Beschädigung zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungsschritten dadurch erreicht, daß benachbart zum ersten Prozeßbehälter ein
 zweiter Prozeßbehälter vorgesehen ist, dessen eine Wand zumindest teilweise die die Öffnung enthaltende Behälterwand des ersten
 Prozeßbehälters ist und die Öffnung von der Seite des ersten Prozeßbehälters her schließbar ist.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		